



ව්‍යුහය හා ඛණ්ඩන -2

Chemistry

General Certificate of **ADVANCED LEVEL**

විද්‍යා ඉල්ලා
නොමැත තරුවල...

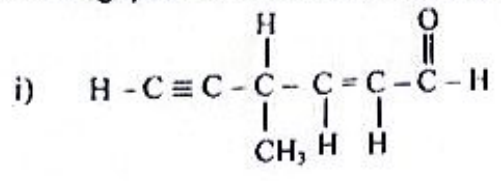


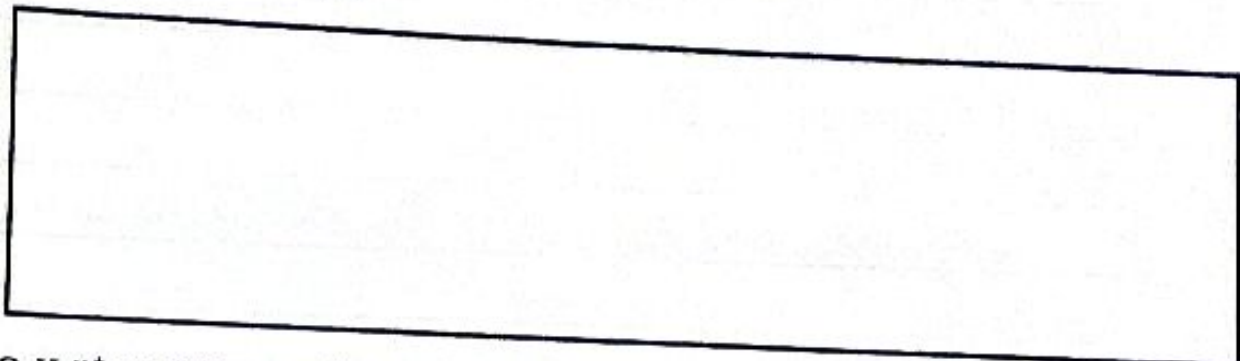
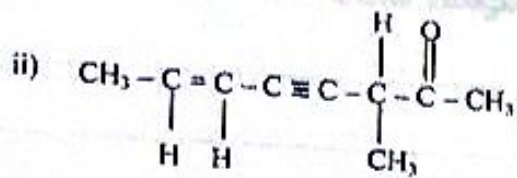
KELUM SENANAYAKE

B.Sc (Hon's) (U.S.J.) P.G. Dip in Edu

v) BeCl_2	vi) BCl_3
vii) OF_2	viii) NO_3^-
ix) HNO_3	x) SO_4^{2-}
xi) H_2S	xii) O_3

03. පහත දී ඇති සංයෝගයට අදාළ සැකිලි ව්‍යුහය ලක්වන්න.





04. H_2O , H_3O^+ සහ OH^- යන ප්‍රභේද වල ඔක්සිජන් පරමාණුවේ විද්‍යුත් කැණ්‍යාවය වැඩිවන පිළිවෙලට සකස් කරන්න. ඔබේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.

05. NO_2^+ , NO_3^- , NH_3 යන ප්‍රභේද වල නයිට්‍රජන් පරමාණුවේ විද්‍යුත් කැණ්‍යාවය වැඩිවන ආකාරයට සකස් කරන්න. ඔබේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.

06. NO^+ , NO_2^+ , NH_4^+ යන ප්‍රභේද වල නයිට්‍රජන් පරමාණුවේ විද්‍යුත් කැණ්‍යාවය වැඩිවන ආකාරයට සකස් කරන්න. ඔබේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.

බන්ධන දිග සන්සන්දනාය කිරීම

07. CO , CO_2 , CO_3^{2-} වල C - O බන්ධන දිග වැඩිවන ආකාරයට ප්‍රතිචක්ත.

08. NO_3^- , NO_2^- , NO^+ වල N - O බන්ධන දිග වැඩිවන ආකාරයට ප්‍රතිචක්ත.

09. NO_3^- , NO_2 , F සහ NO_4^{3-} යන ප්‍රභේද වල N - O බන්ධන දිග වැඩිවන ආකාරයට දැක්වන්න.

10. NH_2OH , NO , NO_2 , NO_3^- යන එවැනි N - O බන්ධන දුර අඩුවන නිවැරදි අනුපිළිවෙල දැක්වන්න.

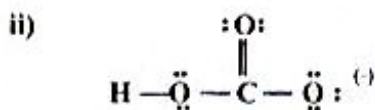
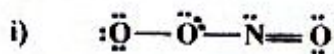
11. NO_3^- , NO_2 , NH_2OH , $CINO$ N - O බන්ධන දුර අඩුවන නිවැරදි අනුපිළිවෙල දැක්වන්න.

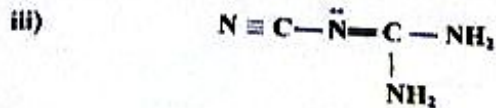
12. NO , FNO_2 , $CINO$, NH_2OH වල N - O බන්ධන දිග වැඩිවන ආකාරයට සකසන්න. ඔබේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.

13. NO_2^- , NO_3^- , NO_2^+ වල N - O බන්ධන ශක්තිය වැඩි වන ආකාරයට සකසන්න.

14. SO_3^{2-} , SO_4^{2-} , SO_2 වල S - O බන්ධන ශක්තිය වැඩි වන ආකාරයට සකසන්න.

15. ආකෘත බන්ධන ශෝණ ද්‍රව්‍යවලින් පහත ඉවත් වන්නන් හි දූ භෘතිය දක්වන්න. 2012





16. Xe, CH₃Cl, HF

ඉහත ද්‍රව්‍යවල ඇති ද්‍රව්‍ය අතුරින් කුමන එක/එවාට පහත ද්‍රව්‍යවල ඇති බල හිමිවේ ?

- i) ද්‍රව්‍යවල - ද්‍රව්‍යවල බල
- ii) හයිඩ්‍රජන් බන්ධන බල
- iii) ලන්ඩන් අපකිරණ බල

17. Ne, CHCl₃ සහ H₂O

ඉහත ද්‍රව්‍යවල ඇති ද්‍රව්‍ය අතුරින් කුමන එක/එවාට පහත ද්‍රව්‍යවල ඇති බල හිමිවේ ?

- i) ද්‍රව්‍යවල - ද්‍රව්‍යවල බල
- ii) හයිඩ්‍රජන් බන්ධන බල
- iii) ලන්ඩන් අපකිරණ බල

18. CO₂, SO₂, NH₃ සහ XeCl₂

ඉහත ද්‍රව්‍යවල ඇති ද්‍රව්‍ය අතුරින් කුමන එක/එවාට පහත ද්‍රව්‍යවල ඇති බල හිමිවේ ?

- i) ද්‍රව්‍යවල - ද්‍රව්‍යවල බල
- ii) හයිඩ්‍රජන් බන්ධන බල
- iii) ලන්ඩන් අපකිරණ බල

19. Ar, CH₃OH, ^{CHCl₃}CH₂ සහ XeCl₂

ඉහත ද්‍රව්‍යවල ඇති ද්‍රව්‍ය අතුරින් කුමන එක/එවාට පහත ද්‍රව්‍යවල ඇති බල හිමිවේ ?

- i) ද්‍රව්‍යවල - ද්‍රව්‍යවල බල
- ii) හයිඩ්‍රජන් බන්ධන බල
- iii) ලන්ඩන් අපකිරණ බල

20. පහත ප්‍රභේද අතර පවතින අන්තර් අණුක අන්තර්ක්ෂණ බල ස්ථාපනය කරන්න.

01. H_2O/CH_3OH

03. CH_3OH/I_2

05. I_2/KI

07. C_6H_6/Br_2

09. H_2O/Cl_2

11. CCl_4

13. CO_2

15. $CHCl_3$

17. PH_3

02. NO_2

04. $NH_3/CHCl_3$

06. KI/H_2O

08. $H_2O/NaCl$

10. HF

12. $CH_3COCH_3/CHCl_3$

14. Cl_2

16. XeF_4

18. HCl

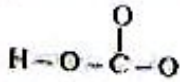
21. Ne, SO_2, H_2O සහ CH_4 වල ආපාංතය වැඩි වන අනුරූපව සකසන්න.

22. CO_2, N_2, CH_4 සහ Ar වල ආපාංතය වැඩි වන අනුරූපව සකසන්න.

23. NH_3 , He , SO_2 සහ O_2 වල ආපාංකය වැඩි වන අනුපාතයට සකස්කර.

(2011 A/L)

24) පහත දී ඇති (i)-(vi) කොටස් බයිකාබනේට් අයනය, HCO_3^- මත පදනම් වේ. HCO_3^- හි සැකිල්ල පහත දී ඇත.



i) මෙම අයනය සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ඉවිස් ව්‍යුහය ඇඳීම.

ii) මෙම අයනයෙහි සම්පූර්ණ ව්‍යුහ ඇඳ, ඒවායේ සාපේක්ෂ ස්ථායීතාව පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම.

iii) VSEPR වාදය භාවිත කරමින් පහත දී ඇති පරමාණු වටා හැඩ ඇරෙන්නය කරන්න.

I. C _____

II. H O සම්බන්ධිත O _____

iv) පහත දී ඇති පරමාණු වටා ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන ජනමිතිය (ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් සැකසුම) දෙන්න.

I. C _____

II. H O සම්බන්ධිත O _____

v) පහත දී ඇති පරමාණුවල මුහුම්කරණ දැක්වන්න.

I. C _____

II. H O සම්බන්ධිත O _____

vi) ඉහත (i) හි ඇඳූ ලද ඉවිස් ව්‍යුහයෙහි අඩංගු පහත දී ඇති σ බන්ධන සෑදීම සඳහා සහභාගි වන පරමාණු කාක්ෂික / මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න.

I. H O සම්බන්ධිත C හා O අතර _____

II. O හා H අතර _____

(2012 A/L)

25. a) පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නවලට දී ඇති නිදහස් මත පිළිතුරු සපයන්න.

i) ක්‍රෝමලාව පවතින Fe^{3+} , Cr^{3+} සහ Cu^{2+} යන අයන තුන අතුරින් විද්‍යුත්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන තුනක් ඇත්තේ කුමකටද ?

ii) 3d ශාඛාවේ Ti, V සහ Cr යන මූලද්‍රව්‍ය තුන අතුරින්, ඛණ්ඩක සැලීමේදී උපරිම වශයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන පහක් සහභාගී විය හැකි මූලද්‍රව්‍යය කුමක්ද ?

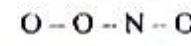
iii) C, N, හා Si යන මූලද්‍රව්‍ය තුන අතුරින් , අඩුම ව්‍යුත්සාශ්‍රතාව ඇත්තේ කුමකටද ?

iv) Na, Mg හා Al යන මූලද්‍රව්‍ය තුන අතුරින්, වැඩිම පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය ඇත්තේ කුමකටද ?

v) N^{3-} , O^{2-} හා F^{-} යන සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ඇනායන තුන අතුරින්, විශාලතම අයනික අරය ඇත්තේ කුමකටද ?

vi) Na^{+} , Ca^{2+} හා Al^{3+} යන කැටායන තුන අතුරින්, කුඩාම අයනික අරය ඇත්තේ කුමකටද ?

b) ආම්ලික ප්‍රදාය කැටිට්ටිට්ටි ද්‍රාවණ H_2O_2 භාවිතයෙන් කැටිට්ටිට්ටි බවට මත්ස්නරණය කිරීමේදී අතරමැදි ඵලයක් ලෙස පොරොක්සොනයිට්ට් අම්ලය ($HOONO$) සෑදේ. පොරොක්සොනයිට්ටිට්ටි අයන $[OONO]^{-}$ සම්බන්ධයෙන් (i) සිට (vii) තෙක් කොටස් සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. එහි සැකිල්ල පහත දී ඇත.



i) මෙම අයනය සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ඉඩස් ව්‍යුහය ඇඳන්න.

ii) මෙම අයන සඳහා සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ ඇඳන්න. හේතු දැක්වමින් ඒවායේ සාපේක්ෂ ස්ථායීතා පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න.

iii) VSEPR වාදය භාවිතා කරමින් හත පරමාණු වටා ඇති හැඩ ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

I) N

II) N සහ O යන දෙකටම බැඳුණු O

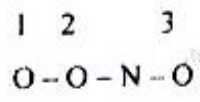
iv) පහත දී ඇති වගුවෙහි,

- I) පරමාණු වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය (ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් වල සැකසුම)
- II) පරමාණුවල මුහුම්කරණය සඳහන් කරන්න.

	N	N සහ O යන දෙකටම බැඳුණු O
ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය		
මුහුම්කරණය		

v) ආසන්න ඛන්ධන කෝණ දක්වමින් ඉහත (i) කොටසෙහි අදින ලද ලුවීස් ව්‍යුහයේ හැඩය දළ සටහන් කරන්න.

vi) ඉහත (i) කොටසෙහි අදින ලද ලුවීස් ව්‍යුහයෙහි පහත දක්වා ඇති ඛන්ධන සැදීම සඳහා සහනාතී වන පරමාණුක/මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න. පහත දැක්වෙන පරිදි මත්සිපත් පරමාණු 1, 2 සහ 3 ලෙස නම් කර ගැන.



1) O සහ O -----

2) O සහ N -----

vii) පොරොන්සිකයිට්ස් අම්ලයෙහි සමාවයවිතයක් දෙන්න.

c) i) පහත දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් ධ්‍රැවීය විශේෂ දෙකක් තෝරන්න.

H_2CO (හෝමොලොගයිසි) SF_6 , COS , ICl_4^+ , $SiCl_4$ ----- සහ -----

ii) පහත දැක්වෙන එක් එක් යුගලයේ අණු අතර පවතින අන්තර්අණුක බල වර්ගය / වර්ග සඳහන් කරන්න.

I) $HBr(g)$ සහ $H_2S(g)$ -----

II) $Cl_2(g)$ සහ $CCl_4(g)$ -----

III) $CH_3OH(l)$ සහ $H_2O(l)$ -----

(2013 A/L)

26. a) එරහන් තුළදී ඇති ශුභාය වැඩිවන පිළිවෙලට පහත සඳහන් දෑ සකසන්න. හේතු අවශ්‍යය නොවේ.

i) CO, CO_2, CO_3^{2-} (C-O බන්ධන දුර)

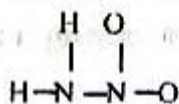
ii) NO_2^+, NO_3^+, NH_3 (N පරමාණුවෙහි විද්‍යුත් සාඝාතාව)

iii) $BeSO_4, MgSO_4, CaSO_4$ (විශේෂිත උෂ්ණත්වය $MSO_4 \rightarrow MO + SO_3$, M = ලෝහය)

iv) Ne, Ar, Kr (නාපාංකය)

v) S, F, Si, Cl (පරමාණුක අරය)

b) නයිට්‍රොසයිඩ (N_2N-NO_2) උබල අම්ලයකි. හේමයක් හමුවේ දී එය N_2O සහ H_2O බවට විශේෂනය වේ. නයිට්‍රොසයිඩ මත පදනම් වී ඇති (i) සිට (v) කොටස්වලට පිළිතුරු සපයන්න. එහි සැකිල්ල පහත දී ඇත.



i) මෙම අණුව සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ඉවිස් ව්‍යුහය අඳින්න.

ii) මෙම අණුව සඳහා සම්පූර්ණ ව්‍යුහ ඇඳීම. හේතු දක්වමින් ඒවායේ ස්ථායීතා පිළිබඳ අදහස් දක්වන්න.

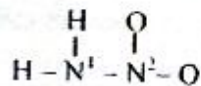
iii) පහත දී ඇති වගුවෙහි දක්වා ඇති

- I. පරමාණු වටා ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ප්‍රකාශිතය (ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලවල සැකසුම)
- II. පරමාණු වටා ඇති හැඩය
- III. පරමාණුවල මුහුම්කරණය සඳහන් කරන්න.

	H පරමාණු දෙකකට බැඳුණු N	O පරමාණු දෙකකට බැඳුණු N
I. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ප්‍රකාශිතය		
II. පරමාණු වටා ඇති හැඩය		
III. පරමාණු වල මුහුම්කරණය		

iv) මෙම අණුව ධ්‍රැවය ද නැතහොත් නිර්ධ්‍රැවයද ?

v) ඉහත (i) කොටසෙහි ඇඳි ලද ලුවීස් ව්‍යුහයෙහි පහත දක්වා ඇති ඛණ්ඩන සෑදීම සඳහා සහභාගිවන පරමාණුක/මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න. පහත දැක්වෙන පරිදි N පරමාණු 1 සහ 2 ලෙස නම් කර ඇත.



- I) N¹ සහ N² _____
- II) N¹ සහ H _____

b) Xe, CH₃Cl, HF

ඉහත දක්වා ඇති ප්‍රභව අතරින් කුමන එක/ඒවාට පහත දක්වා ඇති බල හිමිවේ ?

- i) ද්‍රව්‍ය - ද්‍රව්‍ය බල _____
- ii) හයිඩ්‍රජන් බන්ධන බල _____
- iii) ලන්ඩන් අපකිරණ බල _____

(A/L - 2014)

27. a) වරහන් තුළ දී ඇති ගුණය අඩුවන පිළිවෙළට පහත සඳහන් දෑ සකසන්න. (තම විෂය)

i) Li, Na, Mg, Al, Si (පළමු අයනීකරණ ශක්තිය)

ii) C, O, F, ~~X~~, Cl (පළමු ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධනාංගය) **තම විෂය නිර්වචනයට අනුව ඒකකවලට වැඩිකිරීමේ වේ.**

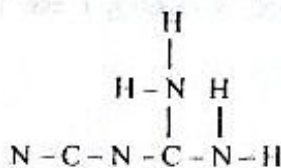
iii) BaCl₂, CaCl₂, BeCl₂, (ද්‍රව්‍යාංකය)

iv) NCl₃, SiCl₄, ICl₄⁻, (බන්ධන කෝණය)

v) H₂O, H₃O⁺, OH⁻ (බන්ධන පරමාණුවේ විද්‍යුත් සාමාන්‍යතාව)

vi) NO⁺, FNO₂, C/NO, NH₂OH (N - O බන්ධන දිග)

b) 2-සයනෝගුවනිඩින් (C₂H₆N₄) කෘෂිකර්මයේ දී බහුල ව භාවිත කෙරෙන රසායනික ද්‍රව්‍යයකි. පහත දී ඇති (i) සිට (v) ප්‍රශ්න 2-සයනෝගුවනිඩින් මත පදනම් වී ඇත. එහි සැකිල්ල පහත දී ඇත.

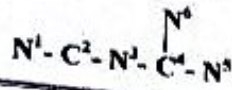


i) මෙම අණුව පදනම් වන වඩාත්ම පිළිගත හැකි ඉඩස් ව්‍යුහය අඳින්න.

ii) මෙම අණුව පදනම් වන (ඉහත (i) හි අඳින ලද ව්‍යුහය හැට්ටසම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ හතරක් අඳින්න.

- iii) පහත වගුවෙහි දැක්වා ඇති C හා N පරමාණුවල
- I. පරමාණුව වටා ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජනමිතිය (ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල සංඛ්‍යාව)
 - II. පරමාණුව වටා ඇති හැඩය.
 - III. පරමාණුවේ මුහුම්කරණය සඳහන් කරන්න.

2- සයනෝගුවලින්වල කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු පහත දැක්වා ඇති ආකාරයට ලේඛිත කර ඇත.



		C ²	N ³	C ⁴	N ³ හෝ N ⁵
I.	ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජනමිතිය				
II.	හැඩය				
III.	මුහුම්කරණය				

- iv) ඛන්ධන තෝණවල ආසන්න අගයයන් දැක්වීමේ ඉහත (i) කොටසෙහි අදිත ලද ලුවීස් ව්‍යුහයේ හැඩයේ දළ සටහනක් අඳින්න. (N - H ඛන්ධන හා සම්බන්ධ තෝණ හැර අතිරේක සියලුම ඛන්ධන තෝණ පෙන්වන්න)

- v) ඉහත (i) කොටසෙහි අදිත ලද ලුවීස් ව්‍යුහයෙහි පහත දැක්වා ඇති σ - ඛන්ධන සෑදීම සඳහා සහභාගි වන පරමාණුක/මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න. (පරමාණුවල අංකන (iii) කොටසෙහි ආකාරයට වේ)

- I. N¹ - C² N¹ _____ C² _____
- II. C² - N³ C² _____ N³ _____
- III. N³ - C⁴ N³ _____ C⁴ _____

c) CH₃Cl (තාපාංකය 249 K) සහ CH₃I (තාපාංකය 316 K) යන රසායනි ද්‍රව්‍ය දෙක සලකන්න.

- i) වඩා විශාල ද්‍රවී ධ්‍රැව ඝූර්ණය ඇත්තේ කුමන ද්‍රව්‍යයටද?

- ii) වඩා ප්‍රබල ලන්ඩන් අපකිරණ බල ඇත්තේ කුමන ද්‍රව්‍යයටද?

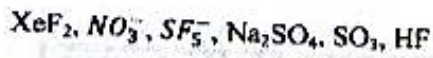
- iii) වඩා ප්‍රබල මුළු අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල ඇත්තේ කුමන ද්‍රව්‍යයටද?

iv) මෙම ද්‍රව්‍ය දෙක සැසඳීමේදී වඩා ප්‍රමුඛ වන අන්තර් අණුක බල වර්ගය කුමක්ද ?

(විද්‍යුත් සාක්ෂාතාවය $H=2.1, C=2.5, N=2.5, F=2.5, Cl=3.0$)

(2015 A/L)

28. a) පහත සඳහන් රසායනික විශේෂ සලකන්න.

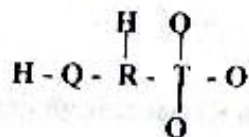


ඉහත විශේෂවලින් කුමක්/කුමක,

- i) අයනික බන්ධන හා සහබන්ධනය යන දෙකම අඩංගු වේ ද? _____
- ii) BF_3 හා සම්ඉලෙක්ට්‍රෝනික වේ ද? _____
- iii) සමවතුරුභාකාර පිරමීඩය හැඩයක් ගනී ද? _____
- iv) එහි වඩාත් ම ස්ථායී ව්‍යුහයේ, බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව හා බන්ධන නො වන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව සමාන වේද? _____
- v) $1s$ පරමාණුක කාක්ෂිකයක් හා $2p$ පරමාණුක කාක්ෂිකයක් අතිවිභාජනය වීම හේතුවෙන් සෑදෙන σ - බන්ධනයක් තිබේද? _____
- vi) 180° බන්ධන කෝණයක් අඩංගු වේ ද? _____

සැ.ප්‍ර.ප්‍රශ්නයකට එක පිළිතුරකට වැඩිය ලියා ඇතිනම් එම ප්‍රශ්නයට ලකුණු ප්‍රදානය නොකරන්න.

b) H_2O_3QRS සංයෝගය ආම්ලික ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරයි. එය පලයේ දිය කළ විට H^+ ඉවත් වී $[H_2O_3QRT]$ ඇනායනය සාදයි. මෙම ඇනායනය සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුවීස් ව්‍යුහයේ, සාමා ආරෝපණය මධ්‍යස්ථ පරමාණුවක් මත පවතී. අනිකුත් පරමාණු මත ආරෝපණ නොමැත. Q, R හා T මූලද්‍රව්‍ය විද්‍යුත් සාක්ෂාතාව 2.0 වඩා වැඩි (පෝලිං පරිමාණය) අලෝභ වේ. Q සහ R මූලද්‍රව්‍ය ආවර්තිතා වලට වේ දෙවන ආවර්තයට අයත් වන අතර T තුන්වන ආවර්තයට අයත් වේ.



- i) Q, R හා T මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න.
 $Q = \text{-----}$ $R = \text{-----}$ $T = \text{-----}$
- ii) මෙම ඇනායනය සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුවීස් ව්‍යුහය අඳින්න.

සැ.ප්‍ර. b(i) හි Q, R හා T සිවැරදිව හඳුනාගෙන ඇතිවිට Q, R හා T යොදා ගනිමින් සිවැරදි ලිවිය යුතුය ඇදීම සඳහා ලබාදුන් ප්‍රධාන සටහන.

iii) මෙම ඇහැයනය සඳහා සම්පූර්ණව ව්‍යුහ ගයක් ඇඳීම.

iv) පහත දැක්වූ ඇති වගුවේ Q, R හා T පරමාණුවල

- I) පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය (ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල සැකසුම)
- II) පරමාණුව වටා හැඩය
- III) පරමාණුවේ මුහුම්කරණය
- IV) පරමාණුව වටා ඔක්ධන කෝණයේ ආසන්න අගය සඳහන් කරන්න.

	Q	R	T
i. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය			
ii. හැඩය			
iii. මුහුම්කරණය			
iv. ඔක්ධන කෝණය			

v) ඉහත (ii) කොටසේ ඇඳූ ලද ලිවිය යුතුයෙහි පහත දැක්වූ ඇති σ- ඔක්ධන සෑදීම සඳහා සහභාගි වන පරමාණුක / මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න.

- I. Q - R Q -----, R -----
- II. R - T R -----, T -----
- III. T - O T -----, O -----

සැ.ප්‍ර. b (ii) හි ඉවිස් ව්‍යුහය වැරදි වුවත්, මධ්‍ය පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන සැකසීම නිවැරදි බව b(iv) හා b(v) ට ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න.

vi) I. සහසංයුජ සංයෝගයක / අයහනයක ඉවිස් ව්‍යුහයක් මගින් සෘජුව ලබා දෙන තොරතුරු මොනවාදැයි සඳහන් කරන්න.

1. _____ 2. _____

II. සහසංයුජ සංයෝගයක / අයහනයක ඉවිස් ව්‍යුහයක් මගින් සෘජුව ලබා නොදෙන තොරතුරු මොනවා දැයි සඳහන් කරන්න.

(2017 A/L)

29. a) i)

I. ඉවිස් ව්‍යුහයක ඇති පරමාණුවක ආරෝපණය (Q) නිර්ණය කිරීමට පහත දැක්වා ඇති ප්‍රධානතය N_A , N_{LP} සහ N_{BP} සහ පද සුදුසු කොටුවල ඇතුළත් කිරීමෙන් සම්පූර්ණ කරන්න. මෙහි,

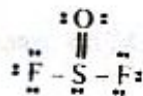
N_A = පරමාණුවේ ඇති සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව

N_{LP} = එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලවල ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව

N_{BP} = පරමාණුව වටා ඛණ්ඩක යුගලවල ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව

$$Q = \boxed{} - \boxed{} - \frac{1}{2} \boxed{}$$

II. N_A , N_{LP} සහ N_{BP} සඳහා අගයන් සුදුසු කොටුවල ඇතුළත් කිරීමෙන් පහත දී ඇති SO_2 ව්‍යුහයෙහි S මත ආරෝපණය, Q (සල්ෆර්) ගණනය කරන්න.

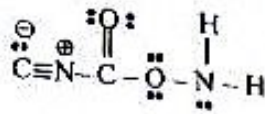


$$Q \text{ (සල්ෆර්)} = \boxed{} - \boxed{} - \frac{1}{2} \boxed{} = \underline{\hspace{2cm}}$$

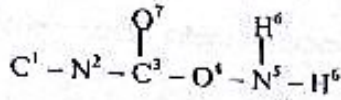
ii) ClO_2F_2 අයනය සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ඉවිස් ව්‍යුහය ඇඳීම.

iii) CH_2SO (සල්ෆික්) අණුව සඳහා වඩාත් ම ස්ථායී ඉවිස් ව්‍යුහය පහත දැක්වා ඇත. මෙම අණුව සඳහා තවත් ඉවිස් ව්‍යුහ (සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ) දෙකක් ඇඳීම.

- iv) පහත සඳහන් උපකල්පිත ලුපිස් ව්‍යුහය පදනම් කරගෙන පහත විභවී දැක්වූ අනි C, N හෝ O පරමාණුවල
- I. පරමාණුව වටා VSEPR යුගල්
 - II. පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය
 - III. පරමාණුව වටා හැඩය
 - IV. පරමාණුවේ මුහුම්කරණය



පහත දැක්වෙන පරිදි පරමාණු අංකනය කර ඇත.



		N ²	C ³	O ⁴	N ⁵
I.	VSEPR යුගල්				
II.	ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය				
III.	හැඩය				
IV.	මුහුම්කරණය				

- v) ඉහත (iv) කොටසෙහි දෙන ලද ලුපිස් ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගී වන පරමාණුව/මුහුම්කාරකයන් හඳුනාගන්න. (පරමාණුවල අංකනය (iv) කොටසෙහි ආකාරයට වේ)

- I. N² - C³ N² ----- C³ -----
- II. O⁴ - N⁵ O⁴ ----- N⁵ -----
- III. N⁵ - H⁶ N⁵ ----- H⁶ -----
- IV. C³ - O⁷ C³ ----- O⁷ -----

- b) i) පහත සඳහන් I, II හා III හි පවතින අන්තර් අණුක බල වර්ගය / වර්ග හඳුනාගන්න.

I. Ar වායුව

II. NO වායුව

IV. KCl ධූමා ප්‍රමාණයක් ප්‍රවණය වී ඇති ජල සාම්පලයක

ii) "n - ඔක්සිජන් (C_4H_{10}) හි සාපාංකය ඉලෙක් (C_7H_8) හි සාපාංකයට වඩා ඉහළ ය." මෙම ප්‍රකාශනය සත්‍ය ද නැත්නම් අසත්‍ය ද යන වග හේතු සහිත ව සඳහන් කරන්න.

iii) වරහන් තුළ දී ඇති ඉහත අඩුවන පිළිවෙළට පහත සඳහන් දෑ සකසන්න. (හේතු අවශ්‍ය නොවේ)

I. $Li_2CO_3, Na_2CO_3, K_2CO_3$ (ජලයෙහි දාව්‍යතාව)

II. $NF_3, NH_3, NOCl, NO_2^+$ (බන්ධන කෝණය)

III. $COCl_2, CO_2, HCN, CH_3Cl$ (කාබන්වල වැදගත් සංඝාතව)

(2018 A/L)

30. a) පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සත්‍ය ද නැත්නම් අසත්‍ය ද යන වග හේතු සහිත ව සඳහන් කරන්න. (හේතු අවශ්‍ය නොවේ)

i) විශාලත්වය වැඩිවීමත් සමඟ කේලයිඩ් අයනවල ධ්‍රැවණශීලීතාවය වැඩි වේ. _____

ii) NO , හි $O - N - O$ බන්ධන කෝණය NO_2^+ හි එම කෝණයට වඩා විශාල වේ. _____

iii) CCl_4 අණු අතර ලන්ඩන් අපකීර්ණ බල SO_2 අණු අතර ලන්ඩන් අපකීර්ණ බලවලට වඩා කුඩා වේ. _____

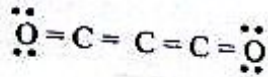
iv) HSO_4^- අයනයේ කැඩය ත්‍රිකෝණීය ද්විපිරමීඩාකාර වේ. _____

v) පරමාණුවක පියලුම 3d පරමාණුක කාක්ෂික (n, l, m_l) 3, 2, 1 යන ක්‍රමයටම අංකවලින් නිරූපණය වේ. _____

vi) වායුමය පොස්පරස් පරමාණුවකට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් එක් කිරීම තාපදායක ක්‍රියාවලියක් වන අතර වායුමය කයිට්‍රේට් පරමාණුවක් සඳහා එය තාප අවශෝෂක වේ. _____

b) i) SF_3N අණුව සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ඉවිස් ව්‍යුහය අඳින්න.

ii) C_3O_2 (කාබන් සවිමත්සයිඩ්) අණුව සඳහා වඩාත්ම ස්ථායී ලුපිස් ව්‍යුහය පහත දැක්වූ ආකාරයට ලියන්න. මෙම අණුව සඳහා තවත් ලුපිස් ව්‍යුහ (සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ) දෙකක් අඳින්න.



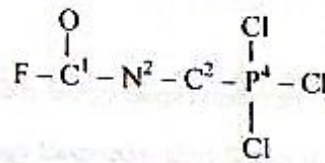
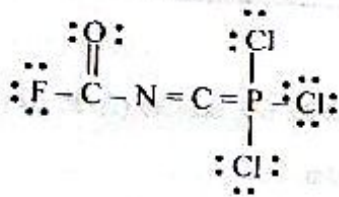
iii) පහත සඳහන් ලුපිස් ව්‍යුහය පදනම් කරගෙන පහත වගුවේ දැක්වූ ආකාරයට C, N හා P පරමාණුවල

i. පරමාණුව වටා VSEPR යුගල්

ii. පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය

iii. පරමාණුව වටා හැඩය.

iv. පරමාණුවේ මුහුම්කරණය



		C^1	N^2	C^3	P^4
i	VSEPR යුගල්				
ii	ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය				
iii	හැඩය				
iv	මුහුම්කරණය				

iv) ඉහත (iii) කොටසෙහි දෙන ලද ලුපිස් ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක / මුහුම්කාරක හඳුනාගන්න. (පරමාණුවල අංකනය (iii) කොටසෙහි ආකාරයට වේ.)

i. $F - C^1$ F ----- C^1 -----

ii. $C^1 - N^2$ C^1 ----- N^2 -----

iii. $N^2 - C^3$ N^2 ----- C^3 -----

iv. $C^3 - P^4$ C^3 ----- P^4 -----

v. $P^4 - Cl$ P^4 ----- Cl -----

v) ඉහත (iii) කොටසෙහි දෙන ලද ලුපිස් ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් π බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක කාරක හඳුනාගන්න. (පරමාණුවල අංකනය (iii) කොටසෙහි ආකාරයට වේ.)

i. $N^2 - C^3$ N^2 ----- C^3 -----

ii. $C^3 - P^4$ C^3 ----- P^4 -----

c) වරහන් තුළ දක්වා ඇති ගුණය වැඩිවන පිළිවෙලට පහත සඳහන් ලද සකස්කිරීම්.

i) B, Na, P, Be, N (පළමු වන අයභීකරණ ශක්තිය)



ii) NH₃, NOCl, NO₂Cl, NH₄⁺, F₃C - NC (කපිප්පත්වල විද්‍යුත් ඍණතාව)



iii) පරමාණුවක ඉලෙක්ට්‍රෝනවල ක්වැන්ටම් අංක (n, l, m_l, m_s)

(3, 1, 0 - 1/2), (3, 0, 0 + 1/2), (2, 0, 0 + 1/2), (2, 1, +1, + 1/2), (3, 2, -1, + 1/2) (ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ශක්තිය)



(2019 A/L)

31. a) පහත සඳහන් ප්‍රශ්න ආවර්තිතා වගුවේ දෙවන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය හා සම්බන්ධ වේ. කොටස් (i) සිට (iv) දක්වා පිළිතුරු දීමේ දී ලබා දී ඇති අවකාශයේ මූලද්‍රව්‍යයේ සංකේතය ලියන්න.

i) වැඩිම විද්‍යුත් ඍණතාව ඇති මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. (උච්ච වායුව නොසලකා හරින්න) _____

ii) විද්‍යුතය සන්නයනය කරන බහුරූපී ආකාරයේ ඇති මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. _____

iii) ප්‍රමාණයෙන් විශාල ම ඒකපරමාණුක අයනය සාදන මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. _____

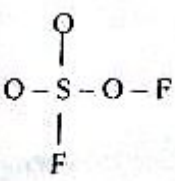
(මෙම අයනය ස්ථායී විය යුතුය.) _____

iv) P ඉලෙක්ට්‍රෝන නොමැති නමුත් ස්ථායී s වින්‍යාසයක් ඇති මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. _____

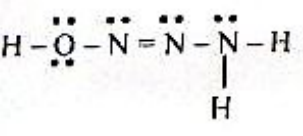
v) වැඩිම පළමු අයභීකරණ ශක්තිය ඇති මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. _____

vi) බොහෝවිට ඉලෙක්ට්‍රෝන උෂ්ණ තලීය ක්‍රියෝස්තාතාර සහසංයුජ සංයෝග සාදන මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. _____

b) i) SO₃F₂ අණුව සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුවීස් හිත් - ඉරි ව්‍යුහය අඳින්න. එහි සැකිල්ල පහත දක්වා ඇත.



ii) H₃N₂O අණුව සඳහා වඩාත් ම ස්ථායී ලුවීස් හිත් - ඉරි ව්‍යුහය පහත දක්වා ඇත. මෙම අණුව සඳහා තවත් ලුවීස් හිත් - ඉරි ව්‍යුහ (සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ) දෙකක් අඳින්න. ඔබ විසින් අඳින ලද වඩා අස්ථායී ව්‍යුහය යටින් 'අස්ථායී' ලෙස ලියන්න.



iv) ඉහත (i) කොටසෙහි අදිත ලද ඉවිස් ව්‍යුහයෙහි වැඩි විද්‍යුත් සාක්ෂාතාවයක් ඇත්තේ N^2 හෝ N^1 ට දැයි සඳහන් කරන්න. ඔබේ තෝරා ගැනීමට හේතු දක්වන්න. [පරමාණුවල අංකන (iii) කොටසෙහි ආකාරයට වේ.]

v) ඉහත (i) කොටසෙහි අදිත ලද ඉවිස් ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුවක/මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න. [පරමාණුවල අංකන (iii) කොටසෙහි ආකාරයට වේ.]

- I. $N^1 - C$ N^1 _____ , C _____
- II. $C - N^2$ C _____ , N^2 _____
- III. $N^2 - N^3$ N^2 _____ , N^3 _____
- IV. $N^3 - N^4$ N^3 _____ , N^4 _____

c) පහත දැක්වෙන ප්‍රධාන සත්‍ය ද නැතහොත් අසත්‍ය ද යන බව සඳහන් කරන්න.

- i) SF_6 සහ OF_6 යන දෙක ම ස්ථායී අණු වේ _____
- ii) $SiCl_4$, NCl_3 සහ SCl_2 හි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය වෙනස්වනුයේ ප්‍රචල, ඒවායේ බන්ධන කෝණ වෙනස් ය. _____
- iii) Kr හි කාපාංකය Xe හි කාපාංකයට වඩා වැඩි ය _____
- iv) II වන කාණ්ඩයේ සල්ෆේට්වල ද්‍රාව්‍යතාව කාණ්ඩයේ පහළට යන විට අඩු වන්නේ මූලික වශයෙන් කැටානවල සමීකරණ එන්තල්පිය අඩුවන නිසා ය. _____

33. පහත දැක්වෙන වලංගු වන පිරිසවල නිස්තර්ණ වී පහතින් A, B, C, සහ D වර්ග යටතේ අදාළ පිරිස සඳහා පහත දී ඇති වචනය / වාක්‍ය ඔබේ අදහස් පමණක් වඩාත්ම සුදුසු ඒවා තෝරා ගනිමින් පූර්වකරන්න.

ද්‍රව්‍යය	A ද්‍රව්‍ය වර්ගය	B දැලියෙහි ස්ථාන ගත අංශු	C අංශු අතර අන්තර් ක්‍රියා	D විද්‍යුත් ලක්ෂණ
දියමන්ති	දැලියක්	තනික	වැඩිපුර	විද්‍යුත් උපාංගයක්
KF(s)	දැලියක්	දැලියක්	වැඩිපුර	දැලියක්
අධිස් (ice)	දැලියක්	දැලියක්	වැඩිපුර	දැලියක්
Li(s)	දැලියක්	දැලියක්	වැඩිපුර	දැලියක්

A : අයනික දැලිය , යෝධ සහසංයුජ දැලිය , ලෝහක දැලිය , අණුක දැලිය , අස්ථිර දැලිය .

B : පරමාණු , බන්ධන අංශු , සාමාන්‍ය අංශු , බන්ධන සහ සාමාන්‍ය අංශු , අණු , ඉලෙක්ට්‍රෝන

C : සහ සංයුජ බන්ධන , වැඩිපුර අන්තර් ක්‍රියා , හයිඩ්‍රජන් බන්ධන , ලෝහක බන්ධන , ස්ථිර විද්‍යුත් අන්තර් ක්‍රියා

D : සන්නායක , ධ්‍රැවණය , විද්‍යුත් විච්ඡේදන

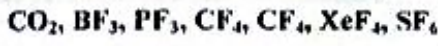
(A/L 2010)

34. පහත ප්‍රක්ෂේප වශයෙන් ඇති එක් එක් ද්‍රව්‍යයක ඔක්සිකරණ අංකය එහි ආකාරයද අන්තර් අණුක බලයන් ඇත්තම් එහි ආකාරයද වශයෙන් දී ඇති ඒවායින් තෝරා දිය හැක.

ද්‍රව්‍ය	ඔක්සිකරණ අංකය (අයනික, ද්‍රාව්‍ය සංයුත්, නිර්ද්‍රාව්‍ය සහසංයුත්)	අන්තර් අණුක බලය (ද්‍රව ද්‍රාව - ද්‍රව ද්‍රාව, හයිඩ්‍රජන් බන්ධන, දන්ඩන් බල)
i) අයඩීන් (සක)	නිර්ද්‍රාව්‍ය නිප න්‍යූන	දන්ඩන් බල
ii) කාබන් ඩයොක්සයිඩ් (ද්‍රව)	ද්‍රාව්‍ය සංයුත්	දන්ඩන් බල, දන්ඩන් බල
iii) ආගන් (ද්‍රව)	-	දන්ඩන් බල
iv) සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් (සක)	ද්‍රාව්‍ය සංයුත්	-
v) සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් (වායු)	නිර්ද්‍රාව්‍ය නිප න්‍යූන	දන්ඩන් බල / දන්ඩන් බල

බහුවර්ණ

35. පහත අණු සම්බන්ධයෙන් මිනිස් අම්ල වශයෙන් අසාය වන්නේ ද ? (2017 A/L)



- 1) සියලුම අණුවලට ද්‍රාව්‍ය සහසංයුත් ඔක්සිකරණ අංකය ඇත.
- 2) සියලුම අණුවලට වෙනස් භවයක් ඇත.
- 3) සියලුම අණු අක්ෂරයක නිති අනුගමනය නොකරයි.
- 4) සියලුම අණු නිර්ද්‍රාව්‍ය වේ.
- 5) අණු සඳහා පමණක් ඒවායෙන් මධ්‍ය පරමාණු අසාය වන පරිදි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල පවතී.

36. මධ්‍ය පරමාණුව වටා ක්‍රියානම් ඒවායෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල සහතිකය පදනම් කර ගනිමින් සකසා ඇති අණුවල භවයන් කිහිපයක් ඇත. ඒවා නම්, (2017 A/L)

- 1) ජීවය, කෝණික, පි-සේ.
- 2) ජීවය, T- භවය, පි-සේ.
- 3) ජීවය, ක්‍රියානම් පරමාණුව, T- භවය
- 4) ක්‍රියානම් පරමාණුව, කෝණික, T-භවය
- 5) ජීවය, ක්‍රියානම් පරමාණුව, පි-සේ.

37. හයිඩ්‍රජන් වායුවෙන් $O - N - O$ කෝණය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් අම්ලයන් සහ වේද ? (2017 A/L)

- 1) $NO_2^+ > NO_2^- > NO_2 > NO_4^+$
- 2) $NO_4^+ > NO_2^+ > NO_2 > NO_2^-$
- 3) $NO_2^+ > NO_2 > NO_2^- > NO_4^+$
- 4) $NO_4^+ > NO_2 > NO_2^- > NO_2^+$
- 5) $NO_2^+ > NO_2^- > NO_4^+ > NO_2$

පළමු ප්‍රකාශය	දෙවන ප්‍රකාශය
38. ඔක්සිඩාචන්ද්‍ර අයනයක C - O බන්ධන ස්ථාවර වේ.	ඔක්සිඩාචන්ද්‍ර අයනය ස්ථාවර සම්පූර්ණ වන අතර සම්පූර්ණ වන අතර සම්පූර්ණ වේ. (2017 A/L)

39. SO_2 , SO_3 , SO_3^{2-} , SO_4^{2-} සහ SO_2 සහ රසායනික විශේෂ, ස්ඵටික පරමාණුවේ (S) විද්‍යුත් සංඝට්ටු වැඩිවන පිළිවෙලට සාකච්ඡාව සිටුවා පිළිතුර වනුයේ, (2019 A/L)

- 1) $SO_2 < SO_3^{2-} > SO_2 < SO_3 < SO_4^{2-}$ 2) $SO_2 < SO_4^{2-} < SO_2 < SO_3^{2-} < SO_2$
 3) $SO_3^{2-} < SO_4^{2-} < SO_2 < SO_3 < SO_2$ 4) $SO_2 < SO_3^{2-} < SO_4^{2-} < SO_2 < SO_3$
 5) $SO_2 < SO_4^{2-} < SO_3^{2-} < SO_2 < SO_3$

40. H_2NNO අණුවේ (සැකිල්ල : $H - \overset{H}{\underset{|}{N^1}} - N^2 - O$) නයිට්‍රජන් පරමාණු දෙක අවට (N^1 සහ N^2 ලෙස ලේබල් කර ඇත.) ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය සහ නැඩය පිළිවෙලින් වනුයේ, (2019 A/L)

N^1		N^2	
(1) වකුස්තලීය	පිරමීඩාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	කෝණීය
(2) පිරමීඩාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	කෝණීය
(3) තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	පිරමීඩාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර
(4) වකුස්තලීය	පිරමීඩාකාර	කෝණීය	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර
(5) වකුස්තලීය	කෝණීය	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර

සටහන්
